⑮ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 86062

@Int_Cl_4		識別記号	庁内整理番号		砂公開	昭和62年(198	7)4月20日
C 09 D	3/82 5/00	PMU 102	6516-4J					
C 09 J	7/02	j K V 1 0 3	A - 6770 - 4 J	審査請求	未請求	発明の数	2	(全12頁)

劉発明の名称 辐射線硬化性オルガノポリシロキサン被覆組成物

②特 題 昭61-226306

纽出 願 昭61(1986)9月26日

⑫発 明 者 ジョン ロバート ケ アメリカ合衆国, ミシガン, ミッドランド, ピー. オー.

リーク ボツクス 1709

②発 明 者 ピーター ユイン ク アメリカ合衆国, ミシガン, ミツドランド, キャンバーリ

ワイ ロウ ー レイン 3109

①出 願 人 グウ コーニング コ アメリカ合衆国,ステイト オブ ミシガン,ミッドラン

ーポレーション ド (番地なし)

②代理人 弁理士 青木 朗 外5名

明 細 書

1. 発明の名称

幅射線硬化性オルガノポリシロキサン被覆 組成物

2. 特許請求の範囲

1. 下記の成分 (A) 及び (B):

(A) 全有機基の50~99モル%がメチル基であり、全有機基の1~10モル%が式-RSH
(式中Rは炭素原子数2~8の2価飽和脂肪族炭化水素基を表す)で表されるメルカプト基であり、
(A) 中の残りの有機基がフェニル基又は炭素原子数2~6のアルキル基である、25℃で少なくとも100センチストークの粘度を有するトリオルガノシロキサンポリマー、及び

(B) 一般式:

(CH₂), | QSiO₂₊,

(式中yは1又は2であり、Qはビニル基及び式-R'(CH₂)。CH=CH₂(式中R'は

- (CH₂)₄-又は- (CH₂)₅CH=CH-を 表し、mは1、2又は3の数値を有し、nは3又 は6の数値を有し、pは3、4又は5の数値を有 する)の高級アルケニル基から成る群から独立に 選択された不飽和基であるが、不飽和基の少なく とも50モル%は高級アルケニル基である)のシロキサン単位を分子中に少なくとも2個有し、残 りのシロキサン単位は一般式:

R"xSiO4-R

(式中xは2又は3であり、R"は炭素原子数し~6の飽和1 価炭化水素基を表し、全R"基の少なくとも50モル%はメチル基である)を有する、(A)と相溶性のオルガノシロキサンを含み、成分(A)及び(B)の量が、組成物中のメルカプト基1個に対して合計0.2~2.0個の不飽和基を生じるのに充分である輻射線硬化性組成物。

2. トリオルガノシロキサンで末端が封鎖されたポリジオルガノシロキサンポリマー中の全有段基の95~99モル%がメチル基であり、残りの

基がメルカプト基であるng 弁請求の範囲第1項記載の組成物。

3. トリオルガノシロキサンで末端が封鎖されたポリジオルガノシロキサンポリマーが25℃で100~1000センチストークの粘度を有し、Rがトリメチレン基又は2-メチルトリメチレン基を表す特許請求の範囲第2項記載の組成物。

4. トリオルガノシロキサンで末端が封鎖されたポリジオルガノシロキサンポリマーが本質的にトリメチルシロキサン単位、ジメチルシロキサン単位及び

単位から成る特許請求の範囲第3項記載の組成物。
5. オルガノシロキサン (B) が25℃で25~1000センチストークの粘度を有し、本質的にジメチルシロキサン単位及びアルケニル基が式
-R (CHz)_CH=CHz (式中Rは

- (CHz)。-又は- (CHz)。CH=CH-を 表し、mは1、2又は3の数値を有し、nは3又 は6の数値を有し、pは3、4又は5の数値を有する)で表されるアルケニルメチルシロキサン単位から成るジメチルピニルシロキサンで末端が封鎖されたポリジオルガノシロキサンポリマーである特許請求の範囲第4項記載の組成物。

6. オルガノシロキサン (B) 中の不飽和基が式ーR (CH_z)。CH=CH_z (式中Rは ー (CH_z)。-又はー (CH_z)。CH=CH-を 要し、mは1、2又は3の数値を有し、nは3又 は6の数値を有し、pは3、4又は5の数値を有 する)で表される高級アルケニル基である特許請求の範囲第4項記数の組成物。

7. オルガノシロキサン (B) のシロキサン単位がジメチルシロキサン単位、トリメチルシロキサン単位、トリメチルシロキサン単位、及びアルケニルジメチルシロキサン単位から成る群から独立して選択されたものである特許請求の範囲第6項記載の組成物。

8. オルガノシロキサン(B)中のアルケニル基が5-ヘキセニル基、7-オクテニル基、9-

デセニル基及び 5.9 - デカジエニル基から成る 群から選択されたものである特許請求の範囲第7 項記載の組成物。

9. オルガノシロキサン (B) が1.1.3.3 - テトラメチルー1.3 - ジアルケニルジシロキサンである特許請求の範囲第8項記載の組成物。
10. オルガノシロキサン (B) がジメチルシロキサン単位及び5 - ヘキセニルメチルシロキサン単位の5 - ヘキセニルジメチルシロキサン基で末端が封鎖されたコポリマーである特許請求の範

1. オルガノシロキサン (B) 中のジオルガノシロキサン単位の1.0~4.0 モル%が5-ヘキセニルメチルシロキサン単位である特許請求の範囲第10項記載の組成物。

囲第8項記載の組成物。

12. 基材からの粘着性物質の剝離を改良するため、

(1) 基材に下記の成分 (A) 及び (B) :

(A) 全有機基の 5 0 ~ 9 9 モルソがメチル基であり、全有機基の 1 ~ 1 0 モルソが式 - R S H

(式中Rは炭素原子数2~8の2価飽和脂肪族炭化水素基を表す)で表されるメルカプト基であり、(A)中の残りの有機基がフェニル基又は炭素原子数2~6のアルキル基である、25℃で少なくとも100センチストークの粘度を有するトリオルカノシロキサンボリマー、及び

(B) 一般式:

(式中yは1又は2であり、Qはビニル基及び式ーR'(CH*)。CH=CH*(式中R'はー(CH*)。CH=CH-を要し、mは1、2又は3の数値を有し、nは3又は6の数値を有し、pは3、4又は5の数値を有する)の高級アルケニル基から成る群から独立に選択された不飽和基であるが、不飽和基の少なくとも50モル%は高級アルケニル基である)のシロキサン単位を分子中に少なくとも2個有し、残りのシロキサン単位は一般式:

R " . S i O . . .

(式中xは2又は3であり、R"は炭素原子数1~6の飽和1価炭化水素基を表し、全R"基の少なくとも50モル%はメチル基である)を有する、(A)と相溶性のオルガノシロキサン

を含み、成分(A)及び(B)の量が、組成物中のメルカプト基1個に対して合計 0.2~2.0個の不飽和基を生じるのに充分である輻射線硬化性組成物を施し、

(II) 施した組成物を硬化させるのに充分なエネルギーの輻射線にさらす

ことから成る基材の処理方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、改良された輻射線硬化性シリコーン 組成物及び塗布方法におけるその用途に関する。 詳述すれば、本発明は、メルカプトアルキル官能 基を有するシロキサン及びアルケニル官能基を有 するシロキサンを含み、輻射線に聴露されると硬 化する組成物に関する。

した場合に、極めて顕著であった。

この種の被覆組成物の輻射線硬化に伴う真明細書 対力を変し、米国特許第4,107,390 号明細書 少するためにポリメチルピニルシロキサンラロにポリメチルピニルシロキャンラでで表して、 で変したがよりでででは、 で変したが、大きないでは、 で変したが、 でのは、 でのないが、 でいる。 にいる。 にいる。

シロキサン被覆組成物の輻射線硬化に伴う臭気 を減少させる更に別の試みとして、本特許出願の 譲受人の所有する米国特許出願第713.940 号明細 截は、(a) メルカプト基含有オルガノシロキサ (従来の技術と、。明が解決しようとする問題点)

例えば、基材から粘着性物質及び他の物質の割離性を改良するため、種々の基材に強膜を与えるため、種々の基材に強膜を与えるため、理能されてきた。従来のシロキサン制離性に表すするが、過常、満足な使用性能を有するが、特に退された組成物が引き続きれている。 特にはのような組成物を溶剤又は他の希釈剤のような組成物を溶剤又は他の希釈剤の表でで施すことができれば、付加的な利点が実現される。

メルカプトオルガノ基を有するオルガノボリシロキサン及びポリメチルピニルシロキサン硬化剤を含む輻射線硬化性被覆組成物は、米国特許第3,873,499 号、同第4,064,027 号及び同第4,052,529 号明細書の開示から公知である。しかしながら、これらの組成物は、硬化工程後に不快な臭気を発するので、市場で緩われる。臭気は、特に組成物を薄層塗布、例えば抵波覆工程に使用

ン、 (b) シクロヘキセニルエチル置換基

(C。H・C H・C H・一) を有するシロキサン単位を少なくとも2個有するオルガノシロキサン、及び(c) 光開始剤を含むUV硬化性組成物を教示している。しかしながら、低レベルのUV線及び低レベルの電子ピーム線で硬化するシロキサン被覆組成物がなお求められている。

米国特許第3,907,852 号明細書は、α、αージェンにシランを選択的に 1 分子付加させてαーアルケニルシランを形成させ、これを次にホスフィンと反応させてシリルアルキルホスフィンを形成することを数示している。

米国特許第3.350.351 号明細書は、40モル%の3-シアノプロピルメチルシロキサン単位、58モル%のジメチルシロキサン単位及び2モル%の7-オクテニルメチルシロキサン単位から成るコポリマーの遊離基硬化を数示している。

本発明の目的は、UV又は電子ピーム線にさらされたときに、不快な臭気を発生するという問題を起こすことなく迅速に硬化する改良されたシリ

コーン被覆組成物を提供。ことを目的とする。

(問題点を解決するための手段および作用効果)

本発明の輻射線硬化性組成物は、(A)全有機 基の50~99モル外がメチル基であり、全有機 基の1~10モル外が式-RSH(式中Rは炭素 原子数2~8の2価飽和脂肪族炭化水素基を表す) で表されるメルカプト基であり、(A)中の残り の有機基がフェニル基又は炭素原子数2~6のア ルキル基である、25℃で少なくとも100セン チストークの粘度を有するトリオルガノシロキサ ンで末端が封鎖されたボリジオルガノシロキサ ンボリマー、及び

(B) 一般式:

(CH₁),

QSiOzze

(式中yは1又は2であり、Qはピニル基及び式-R'(CH₂)_a-CH=CH₂(式中R'は-(CH₂)_a-又は-(CH₂)_a-CH=CH-を表し、mは1、2又は3の数値を有し、nは3又

は6の数値を有 、pは3、4又は5の数値を有する)で表される高級アルケニル基から成る群から独立に選択された不飽和基であるが、不飽和基の少なくとも50モル%は高級アルケニル基である)のシロキサン単位を分子中に少なくとも2個有し、残りのシロキサン単位は一般式:

R" .SiO .T.

(式中xは2又は3であり、R"は炭素原子数.1~6の飽和1価炭化水素基を表し、全R"基の少なくとも50モル%はメチル基である〕を有する、(A)と相溶性のオルガノシロキサンを含み、成分(A)及び(B)の量は、組成物中のメルカプト基1個に対して合計0.2~20個の不飽和基を生じるのに充分である。

本発明は、更に、基材を前記組成物で処理して 基材からの粘着性物質の剝離性を改良する方法を 包含する。

本発明の輻射線硬化性組成物は、 (A) メルカ プト官能基を有するオルガノシロキサンポリマー 及び (B) 末端に不飽和アルケニル基を有するオ

ルガノシロキサンから成る成分を混合することに よって得られる。

本発明に最も有用なメルカプト官に基をで少なくといかノシロキサンボリマーな変を有すなくと、と有すなリンロキサンで表演が対域されたボリッロキサンで来流が対域されたボリッロキサンで来流が対域されたボリッロをはでは、ある。ボリマーは25でで100では近辺であるのが好きない。ボリマーをはではでは、ボリマーを含くボリックを含くボークでは、ボリックを含くボークでは、ボリックを含くボークででは、ボリックを含くボークでは、ボークで変がない。がは、より耐くないのでは、より耐くないのでは、より耐くないのでは、よりでいい。

メルカプト官能基を有するオルガノシロキサンポリマー(A)は、式 Z * S i O のジオルガノシロロキサン単位及び式 Z * S i O い * 〔式中 Z は独立してメチル基、フェニル基、炭素原子数 2 ~ 6 のフルキル基及び式 - R S H (式中 R は炭素原子数

2~8の2価値和脂肪族炭化水素基を表す)によって表されるメルカプト基から成る群から選択された有機基を表す)の連鎖末端単位から成る。一般に、ポリマー中の2基は、50~99モル%はメチル基であり、1~10モル%はメルカプト基であり、残りの2基はフェニル基又は炭素原子数2~6のアルキル基、例えばエチル基、イソプロピル基、ブチル基、ベンチル基及びヘキシル基である。

ポリマー (A) 中の全有機基の 9 5 ~ 9 9 モル %がメチル基であり、残りの基がメルカプト基で あって、ポリマー (A) が主としてジメチルシロ キサン単位、トリメチルシロキサン単位、

HSRSi(CH₃)O単位及び

HSRSi(CH₃)₂O₁/2 単位から成るのが好ま しい。

メルカプト基において、Rは炭素原子数2~8の2価の飽和脂肪族炭化水素基、例えばエチレン基、トリメチレン基、2-メチルトリメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、3-エチ

ルヘキサメチレン基、及びオクタメチレン基を表す。メルカプト基、例えば3-メルカプトーとーメチルプロピル基及び3-メルカプトー2-メチルプロピル基は、合成及び臭気の点から好ましい。即ち、これらのメルカプト基を有するポリジオルガノシロキサンより一層便利に合成され、及びノ又は未硬化状態で許容しうる臭気を有する。

ボリマー (A) は、主としてトリメチルシロキ サン単位、ジメチルシロキサン単位及び 3 - メル カプト-2 - メチルプロピルメチルシロキサン単 位、

から成るのが最も好ましい。好ましいメルカプト ポリマー (A) の特定の例を以下に挙げる:

(CH₂),SiO ((CH₂),SiO) 200 (CH₂SiO), Si(CH₂),
| CH₂CH(CH₂)CR₂SH

(CH₂)₂SiO ((CH₂)₂SiO) _{1.0} (CH₂SiO) _{1.0}Si(CH₂)₃ | CH₂CH₂CH₂SH

0~15重量%含んでいてよい。本発明の目的で、 少量の環状物質をなお含んでいるシロキサン又は 一緒に生成した環状物質を揮発により除去したシ ロキサンを使用することができる。

メルカプトポリマーを線状と記載するが、本発明の範囲及び思想内で、微量の非線状シロキサン単位、即ち、SiOz、及びZSiOzzz (式中Zは前記のとおりである)及び微量の他の珪素に結合した基、例えばヒドロキン基及びアルコキシル基(通常、市販のポリジオルカノシロキサン中に存在する)が存在しうる。メルカプトポリマーは非線状シロキサン単位及び他の基を含まないのが好ましい。

本発明の成分 (B) としては、メルカプトポリマー (A) と相溶性であり、一般式 (I):

(式中yは1又は2であり、Qは不飽和基である) のシロキサン単位を分子中に少なくとも2個含む 任意のオルガノシロキサンを使用することができ

(CH₃),SiO ((CH₃),SiO) ... (CH₃SiO) +Si(CH₃),

CH₂CH(CH₃)CH₂CH

(CH₂)₃SiO ((CH₂)₂SiO)₄, (CH₂SiO)₂, Si(CH₂)₃ CH₂CH₂CH₂CH₂SH

本発明の被覆組成物中に使用するメルカプトポ リマーは、周知の方法、例えば、米国特許第 4.107.390 号明細書に記載されている方法で製造 することができる。例えば、適当なメルカプトポ リマーは、周知の加水分解及び平衡方法を用いて メルカプトオルガノ置換シラン又はシロキサンか ら製造することができる。通常、シラン、例えば メルカプトプロピルメチルジクロロシランを過剰 の水中で加水分解し、次いで、CF:SO:H のような 酸触媒を使用して、生成した加水分解物をシクロ ポリジメチルシロキサン及びトリメチルシロキサ ン末端基を含むシロキサンオリゴマーで平衡化す ることによってメルカプトシロキサンを製造する のが好ましい。平衡化操作によって製造した線状 シロキサンは、150cまでの温度で揮発しうる シクロポリジオルガノシロキサンを少量、例えば

る。成分 (B) は、全部一般式 (I) から成るか 又は一般式 (I) の単位及び一般式:

R" . SiO ...

(式中xは2又は3であり、R"は炭素原子数1~6の飽和1個炭化水素基、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソブチル基及びヘキシル基を要し、全R"基の少なくとも50モル%はメチル基である)を有する単位のコポリマーであってよい。

Qで表される不飽和基は、ビニル基及び式:
-R'(CHz)。CH=CHz(式中R'は
-(CHz)。-Qは-(CHz)。CH=CH-を
要し、mは1、2又は3の数値を有し、nは3又は6の数値を有し、pは3、4又は5の数値を有し、pは3でもの数値を有し、なる事から独立に選択される。UV硬化によって発生する臭気は、不飽和基の少なくとも50そル%が高級アルケニル基である場合に、著しく改良されるが、更に臭気の発生を減少又は排除するには、実質的にすべての不飽和基が高級アルケニル基で

あるのが最も好ましい。

式-R'(CH₂)_aCH=CH₂によって表さ れる高級アルケニル基は、少なくとも6個の炭素 原子を含む。例えば、R'が- (CHz)-を妻す 場合、高級アルケニル基は、5-ヘキセニル基、 6-ヘプテニル基、1-オクテニル基、8-ノネ ニル基、9ーデセニル基及び10-ウンデセニル 法を包含する。 R 'が- (CH₂)。CH = CH -を表す場合には、高級アルケニル基は殊に4.7 - オクタジエニル基、5、8-ノナジエニル基、 5. 9-デカジエニル基、6,11-ドデカジエ ニル基及び4、8-ノナジエニル基を包含する。 5-ヘキセニル基、1-オクテニル基、9-デセ ニル基及び5、9-デカジエニル基から成る群か ら選択されたアルケニル基は、アルケニルシロキ サンを製造するため使用するα、ωージエンが容 易に入手しうるため、好ましい。R'が - (CHz)-を表し、基が末端不飽和結合だけを 含むのが一層好ましく、R'が5ーヘキセニル基

成分(B)は、上としてジメチルシロキサン単 位、トリメチルシロキザン単位、アルケニルメチ ルシロキサン単位及びアルケニルジメチルシロキ サン単位から成る群から選択された単位から成る。 本発明の成分(B)を形成するシロキサン単位は、 例えば、トリメチルシロキサン単位、ジメチルシ ロキサン単位、5-ヘキセニルジメチルシロキサ ン単位、5-ヘキセニルメチルシロキサン単位、 ジメチルピニルシロキサン単位、メチルピニルシ ロキサン単位、ジメチル-1-オクテニルシロキ サン単位、メチルーフ~オクテニルシロキサン単 位、9-デセニルジメチルシロキサン単位、9-デセニルメチルシロキサン単位、5,9-デカジ エニルジメチルシロキサン単位、6-ヘプテニル メチルシロキサン単位及びジメチルー8-ノネニ ルシロキサン単位である。

成分(B)の特定の例は、

ViMezSiO(MezSiO):..(HexMeSiO):SiMezVi
ViMezSiO(MezSiO):..(HexMeSiO):SiMezVi
HexMezSiO(MezSiO):..(HexMeSiO).SiMezHex

Me,SiO(Me,SiO), (HexMeSiO),SiMe,

を表すのが最も好ましい。

HexMe:SiOSiMe:Hex 、 Me:SiO(RexMeSiO):。SiMe: 及びHexMe:SiO(Me:SiO):。。SiMe:Hex

(式中 Me はメチル基を表し、Bex は5 - ヘキセニル基を表し、 Vi はピニル基を表す)を包含する。本発明のため最も好ましい成分 (B) ポリマーは、ジメチルシロキサン単位及び5 - ヘキセニルメチルシロキサン基で末端が封頂されたコポリマーである。このような、1.0~4.0 モル%のジオルカノシロキサン単位が5 - ヘキセニルメチルシロキサン単位であるコポリマーが最も好ましい。

本発明の被覆組成物に使用するオレフィンオルガノシロキサンは、数種の方法で製造することができる。例えば、Sill のような反応性基を有する公知シロキサンを、α、αージエン、例えば1.5-ヘキサジエンと反応させることができる。また、アルケニル置換シラン又はシロキサンから周知の加水分解及び平衡方法を用いて適当なオレフィンオルガノシロキサンを製造することができる。

平衡操作によって生成する線状シロキサンが、 150でまでの温度で揮発性のシクロポリジオル ガノシロキサンを少量、例えば0~15重量%含 みうることを注意すべきである。本発明の目的に は、少量の環状物質をなお含むシロキサン、又は 一緒に生成した環状物質を揮発により除去したシ ロキサンを使用すること.. できる。

オレフィンオルガノシロキサンを線状と記載するが、本発明の範囲及び思想内で微量の非線状シロキサン単位、即ち、SiO。及びR"SiO」に(式中R"は前記のものを表す)及び、通常市販のポリジオルガノシロキサン中に存在する微量の他の珪素結合基、例えばヒドロキシ基及びアルコキシ基が存在してもよい。オレフィンポリジオルガノシロキサンは、非線状シロキサン単位及び他の基を含まないのが好ましい。

(A)及び(B)の量が組成物中でメルカプト 基1個に対して合計 0.2~2.0個の不飽和基を提供するのに充分である成分(A)及び(B)の混合物が、輻射線硬化性組成物として有用である。効率のよい硬化のため、(A)及び(B)を組成物中でメルカプト基1個に対して合計 0.4~0.8個の不飽和基を提供する割合で混合するのが好ましく、メルカプト基1個に対して約 0.5個の不飽和基が最も好ましい。

本発明の組成物は、輻射線硬化性組成物に共通

は、1969年のアメリカン・ケミカル・ソサイェティ (American Chemical Society)の刊行物である *Stabilization of Polymers and Stabilisers Processes*に記載されている。これらの抑制剤は、約50ppm 程度の低い濃度で有効である。

紫外線の作用下での本発明の組成物の硬化速度を増加するため、有効量の光増感剤を使用することが望ましい。適当な光トフェノン、ベンスペロン及びアイン、ベンスペロン及びアングになり、ベンスペロンとはアングになり、から、できる。では組成物の硬化ができる。これらのは、約500ppm 程度の温度で光増感剤として有効である。

本発明の組成物は、組成物の輻射線硬化を著し く妨害しない他の非必須成分、例えば顔料及びレ オロジィ調節添加剤を含んでいてよい。 の成分、例えばた増感剤及びゲル化抑制剤を含ん でいてもよい。前記成分の有効量は、簡単な実験 によって決定することができる。

輻射線硬化性組成物は、製造後、少なくとも8 時間、好ましくは少なくとも214時間の間、室温 で硬化又はゲル化しない場合に一層有用である。 本発明の組成物は、輻射線の不存在で室温で24 時間を越えてもゲル化しないことが判った。しか しながら、ある場合には、数日又は数週間にわた ってゲル化が確実に起こらなくするのが望ましい こともある。この目的で、ゲル化抑制剤を本発明 の組成物と、組成物の硬化又はゲル化前の任意の 時点に混合することができる。本発明の組成物に 任意の適当なゲル化抑制剤を使用することができ るが、現在、本発明者に判っている最良の抑制剤 は、2価フェノール及びそのアルキル化誘導体で ある。更に詳述すれば、抑制剤は、ピロカテコー ル若しくはヒドロキノン又はそのモノエーテル又 はアルキル置換ピロカテコール若しくはヒドロキ ノン又はそのモノエーテルである。これらの物質

詳述すれば、 (a) (CH3),SiOい。単位、 (b) アルケニルジメチルシロキサン単位及び (c) SiO』単位から成り、(a) 及び (b) 単位: (c)単位の比が0.6:1~1.1:1であ るコポリマーであって、該コポリマーの珪素と結 合したヒドロキシ基の含有率が 0.7 重量%以下で あるコポリマーとして説明されるトルエン可溶性 シロキサン樹脂のような剝離制御添加剤を使用す ることは、本発明の範囲内に属するものである。 (b) シロキサン単位中のアルケニル基が、式 - R (CH₂)_aCH = CH₁ (式中Rは - (CH₂)"-又は- (CH₂)"CH=CH-を 表し、mは1、2又は3の数値を有し、nは3又 は6の数値を有し、pは3、4又は5の数値を有 する〕で表されるシロキサン樹脂は、組成物の他 の成分と共に一層迅速かつ完全に硬化するので、 本発明の組成物に特に有用である。剝離添加削は、 使用する場合、被覆組成物の5~45重量%の量 で使用するのが典型的である。

所望量の前記成分及び任意の付加的成分を任意

の適当な方法、例えば関い プレンド及び/又は タンプリング法で及び任意の適当な順序で混合す ることによって被覆組成物を製造する。

本発明の組成物は、輻射線硬化性ペイント添加 物、コイル被覆、繊維処理剤、協水性塗料、イン ク等、並びに輻射線硬化性削離塗料として有用で ある。

分野では、制離塗料の量は、一般に、1 m 当たり 約 0.1 ~ 2.0 g である。.

施した本発明の組成物の少なくとも一部を、唱 群された組成物を硬化させ、基材に粘着させるの に充分に長い時間エネルギー線に暴露することに より組成物を硬化させる。施した全組成物を輻射 線にさらし、硬化させるか、又はその一部だけを

本発明の組成物は、紙又はブラスチック被覆紙上の接着剤剝離塗料として特に有用である。前記組成物を薄い層で紙の表面に施して、塗布さとれる紙1㎡当たり約18の量で塗膜を生じることができる。硬化した状態では、これらの薄い塗膜ははないでは、変配の方法で測定して接着剤の改良された剝離性を生じる。前記塗膜を、塗膜の輻射線硬化が損なわれない限り、一層薄い層又は厚い層で施すことを理解すべきである。紙剝離塗料のもできることを理解すべきである。紙剝離塗料の

輻射線にさらし、硬化させ、その後、未硬化組成物を必要に応じて除去することができるものと理解すべきである。

本発明の目的で、エネルギー線は、化学線、例 えば紫外線、X-線及びr線並びに粒子線、例え ばα粒子及び電子ピームから成る群から選択され た輻射線である。前記組成物を硬化させ、基材に 接着させるため、本発明の組成物をエネルギー線 に曝露すべき時間は、組成物に入射する輻射線の エネルギー及び強度に左右される。更に、入射す る輻射線の有効性は、数種のファクターに左右さ れる。例えば、低いエネルギー位子ピームが空気 中より不活性雰囲気、例えば窒素中で有効である ことは知られている。もちろん、入射輻射線の強 度がエネルギー源と組成物との間の距離に反比例 することも良く知られている.どのような形のエ ネルギー線を本発明方法に使用する場合でも、本 発明の組成物を該組成物を硬化させ、基材に接着 させるのに充分な時間瑕疵する。

紫外線は、比較的安全で、低コストで、かつ電

力必要量が低いので、本...明の組成物の硬化に好ましいエネルギー線である。更に、約200~400ナノメーターの波長を有する輻射線を含む紫外線は、このような輻射線が紙上に塗布された本発明の組成物を、下記の実施例に詳述するように、1秒以内に硬化させるので、本発明方法に極めて好ましい。

(実施例)

下記の実施例は、当業者に本発明を説明するため示すものであり、特許請求の範囲に適切に記載した本発明を限定するものではない。 部又はパーセントによる割合はすべて、特に断らない限り、重量による。

<u>例1</u>:製造

冷却器及び温度計を装着したフラスコ中で 1.5 - ヘキサジェン (160g、1.95m)、白金は体

た。

例 3:製造

冷却器、添加ロート及び温度計を装着したフラスコ中で1、5-ヘキサジエン(164g)及び 白金錯体

(0.05g) を混合することによって5-ヘキセニルジメチルクロロシランを製造した。ジメチルクロロシラン(92g) を、ポット温度が40℃を越えないような速度で添加した。混合物を室温で48時間放置した。生成物は、減圧蒸溜により(沸点39~40℃/2.2 mHg) 68%の収率で単難された。

例 4:製造

フラスコ中で 5 - ヘキセニルジメチルクロロシラン(124.27g)、珪素と結合したヒドロキシル基を約4%有するヒドロキシル基で末端が封鎖されたポリジメチルシロキサン(345g)及

(0.18)及ことにより5-ヘキセニルメチルジクロロシラン (58) を混合することにより5-ヘキセニルメチルジクロロシランを製造した。混合物を40 でに加熱して反応を開始させた。混合物に、温度を55 で以下に保持するようにメチルジクロロシラン (120g) を更に満加した。生成物は波圧蒸溜により(沸点67~69 で/2 mHg) 87.6%の収率で単難された。

例 2 : 製造

トルエン(75g)中のシラン(150g)の混合物に水(225g)を添加し、1.5時間ではすることによって5~キセニルメチルジク層を製造した。トルエン層を製造した。トルエン層を設立した。トルエン層を設立した。トリウム水液(115mg)、次いで水(75mg)で3回転落発器(92セ/8mlg)で入りっピングし、塩化マグネシウム及び水分解りにより口過した。加水分解りは理論値19.01%に対して18.6%の一CH。合有率を有する僅かに着色した液体であっ

びトルエン(100g)を混合し、14時間加熱 還流することによって5-ヘキセニル基で末端が 封鎖されたポリジメチルシロキサン流体を製造し た。冷却後、トリエチルアミン(30g)を添加 し、混合物を口過前に2時間攪拌した。口液を真 空下にストリッピングして揮発性物質を1mHgで 100℃まで除去した。残渣をフラー土(5g) と2時間攪拌することにより脱色し、口過して、 無色のポリンロキサン流体370.1gを得た。

<u>例 5</u>:製造

フラスコ中でシクロボリジメチルシロキサン (17.4g)、例2からの5-ヘキセニルメチルジクロロシランの加水分解物 (0.85g)、例4からの5-ヘキセニル基で末端が封鎖されたボリジメチルシロキサン液体 (5.5g)及びKOH(0.1g)を混合し、150℃に5時間加熱することによってジメチルシロキサン単位及び5-ヘキセニルメチルシロキサン単位の5-ヘキセニルメチルシロキサン単位の5-ヘキセニル基が封鎖されたコボリマーを製造した。冷却後、程合物に二酸化炭素を30分間吹き込んでKOHを

1

中和した。物質を口過して、下記の平均式にほぼ 一致するコポリマーを得た。

B1 6

ジメチルシロキサン単位及びメルカプトアルキサン単位の、トリメチルシロキサン単位の、トリメチルシロキサン単位の、トリメチルシロキサン単位及び5ーへを例 5で製造したジメチルシロキサン単位のへ、5ーセニルメチルシロキサン単位ので、5ーセニル基で表面が封頂されたコポリマー(2、2、3 8)と混合することにより輻射線では、物の、5 8 でで1 2 0 0 センチストークの粘度を し、下記の平均式にほぼ一致した。

以下介白

させると、ほとんど不快な臭気が検出されることなく、汚点、摩擦落ち及び移行なしに硬化した。 例 1

メルカプトポリマー I (5g) をジメチルシロキサン単位及び 5 - ヘキセニルメチルシロキサン 単位のピニルジメチルシロキサンで末端が封鎖されたコポリマー (3.15g) と混合して均一な硬化性組成物を得た。ピニルジメチルシロキサンで末端が封鎖されたコポリマーは、25でで310センチストークの粘度を有し、優して下記の平均式に一致した。

組成物を例6と同様にしてポリエチレン被覆紙に施し、電子ピームの下で3メガラドを照射した後、硬化することが観察された。不快臭の程度は、不飽和基のすべてがピニル基である同様の組成物の硬化に比べて著しく波少していた。

この組成物がUV線照射下にも硬化しうることを示すため、2重量%のベンゾフェノンを組成物の一部に添加し、変性した塗膜を前記のポリエチレン被覆紙に施した。塗膜は、70ft/分

(21.3 m/分) の速度でUVランプの下を通過

制難試験のため、モンサント (Monsanto)(登録商標) GMS - 2 6 3 アクリル接着剤を用いて下記の操作により硬化後直ちに積層することによって硬化した別難塗膜を製造した。アクリル接着剤溶液を硬化した塗膜にバード (Bird) バーを用いて3ミルの温潤厚で施した。接着剤を70℃で60秒加熱し、次いで、再び室温に1分冷却した。乾燥した接着剤に60ポンド(27.2 kg)の艶消リソ(matte litho)のシートを施し、生じた積層体を4.5ポンド(2.0 kg)のゴム被覆ロールで圧延し、空温で24時間熱成した。

積層体の制盤試験は、積層体を幅1インチ(2.5 4 cm) のストリップに切断し、紙/シリコーン層から艶消/接着剤層を180 の角度で毎分400インチ(毎分10.2 m) 引っ張ることによって行なった。単層を分離するのに必要な力は、75g/in(29.5g/cd)であった。

この例は、外部二重結合を有する化合物が、内部二重結合を含む化合物よりはるかに容易に、電

子ピーム照射の条件下にメルカプトポリマーで硬化することを示すものである。

メルカプトボリマー 1 (10g)を1.1.3.3ーテトラメチルー1.3ーピス(5ーへキセニル)ジシロキサン (0.68g)と混合し、S2Sクラフト紙上に塗布した。塗膜は、1.5メガラドの電子ピーム線にさらしたとき、汚点、摩擦客ち及び移行なく硬化した。例7に記載したように試験した剝離力は、45g/in (17.7g/cm)であった。

比較のため、メルカプトポリマー L (10g) 及び 1. 1. 3. 3 - テトラメチルー 1. 3 - ジックロヘキセニルエチルジシロキサン (0.70g) 又は 1. 1' - オキシピス (1 - メチルー 1 - シラシクロペンテン) (0.42g) を S 2 S クラフト紙上に塗布し、電子ピーム線にさらした。 それぞれの場合に、塗膜は、 6 メガラドの輻射線にさらした場合でさえ硬化しなかった。

例 9: 比較

この例は、ペンダントアルケニル基だけで末端

- ヘキセニル)ジシロキサン (0.3 4 g) 及びベンソフェノン (0.1 g) を混合することによって製造した。混合物を 5 0 でに加熱してベンゾフェノンを溶解させた。

組成物 B は、メルカプトポリマー I (2.5 g)、例 5 で製造した 5 - ヘキセニル官能基を有するポリマー (2.2 3 g)及びベンソフェノン (0.1 g)を混合することによって製造した。

組成物 C は、メルカプトポリマー E (32.8部)、シクロヘキセニルエチル官能基を有するポリマー (65.7部)及びベンゾフェノン (1.5部)を混合することによって製造した。メルカプトポリマー E は、25 でで約300センチストークの粘度を有し、平均式:

(CH₂)₂SiO ((CH₂)₂SiO)₁₁₂ (CH₂SiO)₁,₂Si(CH₂)₂ | | (CH₂)₂SH

にほぼ一致する、ジメチルシロキサン単位及びメルカプトプロピルメチルシロキサン単位のトリメチルシロキサン基で末端が封鎖されたコポリマーである。シクロヘキセニルエチル官能基を有する

を封頂するトリ チルシロキサンを含むシロキサンが電子ピーム照射の条件下にメルカプトポリマーで、ペンダントアルケニル基の他にアルケニルジメチルシロキサン末端封頂基を含むシロキサン程容易には硬化しないことを示す。

メルカプトポリマーl (5g)及び平均式: (CH₂)₃SiO [(CH₃)₂SiO)₂₃₀ (CH₃SiO)_{1.0}Si(CH₃)₃ (CH₂)₂CH₂CH₂CH₃

にほぼ一致するトリメチルシロキサン基で末端が 封鎖されたポリマー (1.6g) の混合物をS2S クラフト紙上に塗布し、電子ピーム線に唱した。 塗膜は、6メガラドの輻射線にさらしても硬化し なかった。

B(10

この例は、5 - ヘキセニル官能基を有するシロキサン又はシクロヘキセニルエチル官能基を有するシロキサンを含む組成物のUV線硬化速度の比較を示すものである。

組成物 A は、メルカプトポリマー(5 g)、 1、1、3、3 - テトラメチルー 1、 3 - ヒス (5

ポリマー 1 は、 2 5 セで約 2 0 0 0 センチストークの粘度を有し、平均式:

(CH₂)₃SiO ((CH₃)₂SiO)₂₄₃ (CH₃SiO)₃Si(CH₃)₃ | | CH₂CH₂C₄H₇

にほぼ一致する、ジメチルシロキサン単位及びシクロヘキセニルエチルメチルシロキサン単位のトリメチルシロキサン基で末端が封鎖されたコポリマーである。

各組成物を30psiのプレード圧でトレイリン グプレードコーターを用いてS2Sクラフト紙上. に塗布した。塗膜を繋外線中で、入力200ワット/in(78.7ワット/ca)、出力1.4kH/m及び366nmにUV最大を有する20インチ

(50.8 cs) ハノピア (Hanovia)中圧ランプの下を約80 ssの距離で通過させることによって硬化させた。各強膜がランプの下を通過し、なお硬化を達成できた速度を測定することによって強膜の硬化速度を比較した。ランプは、60 (1//分

(1 8.3 m / 分) の速度が 0.5 8 秒の 13 光時間を 生じるように幅 7 インチ (1 7.8 ca) の 忘を有し ていた。組成物 A 及び B 、 6 0 (11/分(1 8.3 m / 分)の速度で硬化したが、組成物 C は 3 0 (1 / 分(9.1 m / 分)以下の速度でしか硬化しなかった。各塗膜は、汚点、摩擦落ち及び移行の状態が認められない場合に、硬化したと見なした。

特許出願人

ダウ コーニング コーポレーション

特許出願代理人

弁理士 育 木 朗

弁理士 西 舘 和 之

弁理士 石 田 も

弁理士 古 質 哲 次

弁理士 山 口 昭 之

弁理士 西 山 雅 也